Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE

60026660 09-02-85

APPLICATION DATE

26-07-83

APPLICATION NUMBER

: 58135115

APPLICANT:

ULVAC CORP;

INVENTOR:

TSUCHIYA KOYO;

INT.CL.

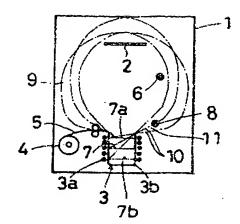
C23C 14/54

TITLE

: CONTROL DEVICE FOR MELT

SURFACE OF SOURCE OF

EVAPORATION



ABSTRACT :

PURPOSE: To monitor exactly the rise and fall of a melt surface and to perform control with high reliability by providing a monitor which senses the flying amt. of an evaporating material in addition to a monitor which controls the rate of evaporation in a treating chamber for vacuum deposition and controlling the supply of the evaporating material.

CONSTITUTION: An evaporating material 5 is fed from a feeder 4 to a crucible 3b and is heated and melted by a coil 3a. A film deposited by evaporation is formed on a substrate 2 by the evaporating material from a source of evaporation 3. An atomic absorption type monitor 6 is provided near the substrate 2 to control the rate of evaporation from the source 3, by which the rate of evaporation is adjusted constant. A monitor 8 which senses the flying amt. of the evaporating material such as an atomic absorption monitor is provided in the position where the flying amt. of the evaporating material changes with the change in the melt surface is provided alongside the source 3. When the evaporating material that comes to fly attains a preset flying amt., the monitor senses the same and stops the operation of the feeder 4 for the material 5, thereby controlling the melt surface of the source 3 constant.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60-26660

識別記号

庁内整理番号 7537-4K

⑬公開 昭和60年(1985) 2月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈蒸発源の溶融面制御装置

20特

頭 昭58-135115

②出

頁 昭58(1983)7月26日

⑫発 明 者 土谷高陽

藤沢市亀井野891-2

⑪出 願 人 日本真空技術株式会社

茅ケ崎市萩園2500番地

四代 理 人 弁理士 北村欣一

外2名

明 組 和

1. 発明の名称

蒸発源の溶融面制御装貨

2 特許請求の範囲

蒸免源からの蒸発による溶酸面の低下に件をない酸蒸発源にワイヤ状その他の蒸発材料を発発では、飲食により供給する式のものに於て、酸系染の側方で溶酸面の変化に伴ない蒸発物の心を発射ので変化する位置に原子吸光式モニタその他の表発物の飛来量を感知するモニタを設け、酸モニタの設定飛来型の感知時に前配供給装置の蒸発等の溶験面制卸設置。

3. 発明の詳細を説明

本発明は主として真空蒸発装置に使用される 蒸発級の溶融面制御装置に関する。

従来。この種族発頭は蒸発による存敗面の低下 に伴ないワイヤ状その他の蒸発材料を供給幾位 により供給して蒸発物のレート変動や蒸剤設の 誤収分の不均一性或は該蒸発源が空加熱状態と

なつて損傷する事故等を防止する必要があるが。 眩溶殷面の低下を真空室内に挿入の光学センサ - や真空室の窓を介して光学的に直視して監視 した場合蒸発物で光学センサーの投受光面や窓 が曇り勝ちで正確に供給装置を駆動して蒸発す 料を供給出来ない欠点がある。また酸蒸発源が 誘導加熱式のものである場合コイルにかかるDC パイプス成分を検出して供給軽値を作動させる ことも提案されたが蒸発物の一部がるつぼに偏 析しそれがDOバイアスの均一性を乱し溶融面 のレベルの一様性が得にくく。現在では蒸発液 よりの蒸発量を経験的に判断してタイマにより 間歇的に供給裝置を作動させて溶融面を制御す るを一般とする。而してこのタイマ式のものは 経験的に供給量を設定してもわずかの裕融レベ ル変動が蒸発物の等分布面を変えるため予定の 展厚が得られず、帝敵温度が変化して生成膜の 収分比を変え取は蒸発頭の破損による異常な溶 殿面の低下を絞し段ず信頼性が欠如し勝ちであ

特開昭GO-26GGO(2)

本発明はこうした欠点等を排し信頼性の高い容 殷面の制御装置を提供することを目的としたも ので、蒸発源からの蒸発による溶融面の低下に 伴ない酸蒸発源にワイヤ状その他の蒸発材料を 供給装置により供給する式のものに於て、該蒸 発派の側方で溶融面の変化に伴ない蒸発物の飛 米が変化する位置に原子吸光式モニタその他の 蒸発物の飛来量を感知するモニタを設け、該モ ニタの設定飛来量の感知時に前記供給装置の蒸 発材料供給作動を供止することを特徴とする。 本発明の実施例を図面につき説明すると、(1)は 真空排気された処理室、(2)は眩室(1)の上方に設 けられた 基板、(3) は 眩室(1) の 下方 に 基板(2) と 対 向させて設けた蒸発源を示し、眩蒸発源(3) は例 えばコイル (3a)によりるつぼ (3b)内にワイヤ状 或は粉末状等で供給装置(4)から供給された蒸発 材料(5)を誘導加熱で岩解する。 基板(2)の 安面に は敗茲発源(3)から蒸発した蒸発材料が敗状に付 **着して蒸霜処理が施されるが、その付着する膜** の成長の底合いは例えば眩藍板(2)の近傍に設け

以上の構成は従来の真空蒸雅装置の構成と特に変わりがないが本発明は酸蒸発源(3)の側方で搭股面(7)の変化に伴ない蒸発物の飛来量が変化する位置に原子吸光式モニタ、電子発光式モニタを設け、先のモニタ(6)にて 蒸発物のレートが一定となるように蒸発源(3)を制御しておき酸モニタ(6)に於て飛来する蒸発物の最が設定飛来量とに放って飛来する蒸発物の最が設定飛来量とに放って飛来する蒸発物の最が設定飛来量とに放って飛来する蒸発物の最が設定飛来量とに放って飛来する蒸発物の最が設定飛来量とになるととを感知した時に蒸発が料(5)の供給で置した。

弦蒸発源(3)から cosin N 乗則に従う広がり(9)で蒸発物が蒸発するが、 眩広がり(9)の下部はほぼ直線的な断面輪郭形状(1)を有し、しかも眩形状(1)は溶融面(7)の上昇、下降とは逆に下降、上昇

する現象を生ずるもので、眩然発源(3)の例方の 眩形状(10)が昇降して蒸発物の飛来が変化する領域(1)にモニタ(8)を設けることにより溶験面(7)が 位置(7a)まで上昇して該輪郭形状(4)が下がると モニタ(8)は蒸発物を感知して供給装置(4)を止め、 また溶験面(7)が位置(7b)まで下降して該輪郭形 状頃が上るとモニタ(8)は蒸発物を感知せず供給 装置(4)に蒸発材料をるつぼ(3b)に供給し、その 繰返して溶験面(7)は一定に維持される。

酸輪郭尼状(10) は通常、るつぼ (3b)の上級を中心 に上下するが、第3 図示のように側方に区画壁 (12を設けてこれを境に膨形状(10) の昇降する領域 (11) が形成されるようにしてもよい。

(8a)(8b)は原子吸光式モニタ(8)を存成する光訊部と光検出部で、該光源部(8a)からの光が蒸発物中を通過する時特定の波長の成分が吸収され光検出部(8b)に検出される成分が減ることで該蒸発物の飛来量が底知され、モニタ(6)もこれと同様の構成をなし得る。(3)は電源(1)はモニタ(5)の出力で作動し、供給モータ(5)の作動制御を行

なりフィーダーコントローラである。

その作動を説明するに蒸発源(3)の溶酸面(7)が予定よりも高くなると蒸発物の下方の輪郭形状間が下降してモニタ(8)に達し、その飛来量が設定値以上であると供給装部形状間が高まり(3)が低いると供給装発源(3)に供きると供給装発源(3)に供きると供給装発源(3)に供きると表替を高いて、で高が、予定位置(7a)まで高値(4)の作動をモニタ(8)が蒸発を感知(7a)まで高値(4)の破損をよるとを繰返す。またるつには3b)の破にこり(3b)の破にでなるととを繰返す。またではは(3b)の破にこれを発したが出来る。

モニタ(8)の出力と溶融面(7)の高さとの関係は第4 図示の如くであり、溶融面(7)が高い位置 (7 a) になるとモニタ(8)の出力は設定出力 A ェりも大きい出力 B となり供給装置(4)を止め、溶融面(7)が低い位置 (7 b)になると小さい出力 O になつて

供給装置(4)を作動させる。

このように本発明によるときは、 蒸発材料の供給 装置を制御するモニタを蒸発 頭の倒方で 溶酸面の昇降に伴ない蒸発物の 飛来が変化する位置に設けたのでモニタに蒸発物が付雅し難くモニタの清掃回数を 減少させ得溶 敝面の昇降を比較的正確にモニタにて監視出来、 そのレベルを一様に維持することが出来る 等の効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の契約例の截断側面図、第2 図はその『一』 線破断面図、第3 図はその変形 例の線図、第4 図はモニタ出力と辞版面の関係 線図を示す。

(3) … 蒸発源 (4) … 供給裝置

(5) … 蒸発材料 (7) … 溶融面

(8) … モニタ

特許出頭人 日本真空技術株式会社 代 理 人 北 村 欣 一

第 1 図

